CIP 法によるレーザー誘起衝撃波伝播解析

Numerical study of the laser-induced shock propagation with the CIP method

内海 隆行,日本原研,〒572-0019 寝屋川市三井南町 25-1, E-mail: utsumi@popsvr.tokai.jaeri.go.jp 佐々木 明,日本原研,〒572-0019 寝屋川市三井南町 25-1, E-mail: sasaki@apr.jaeri.go.jp Takayuki Utsumi, JAERI, 25-1 Miiminami-machi, Neyagawa city, Osaka-fu 572-0019, Japan Akira Sasaki, JAERI, 25-1 Miiminami-machi, Neyagawa city, Osaka-fu 572-0019, Japan

The formation and propagation of the shocks induced by laser irradiation onto the solids are examined in numerical 2D hydrodynamic simulations using the CIP method. The results revealed that the flat thin layer representing shock wave were created by laser absorption and traveled for the time being by the almost same form in the solids. The results would play a role in helping us understand the dynamic structures of materials by optical pump x-ray diffraction probe measurements.

1.概要

レーザー分野の超短パルス発生技術の進歩により、ピコ 秒、フェムト秒といった短時間領域での物質の高速過渡現 象に関わる動的物性研究が急速に発展している。日本原研 においても先端的光量子光源の開発とその応用研究の一環 として超短パルス・高ピーク出力で繰り返し動作可能な cirped-pulse amplification (CPA)方式レーザー(Ti: Sapphire レーザー:100テラワット(TW)20フェムト秒(fs)10Hz) などが開発された。こういった超短パルス・高ピーク出力 レーザー光をポンプ光と超短X線パルスプローブ光生成に 分岐し、ポンプパルスにより試料物質中に誘起した物性変 化をX線回折像として取得する図1に示すような極短時間 分解X線回折システムを構築することができる⁽¹⁾。





図1のシステムでは、レーザーシステムからの光はビー ムスプリッターでポンプ光とプローブ光を生成するビーム に分岐される。後者は固体ターゲット上に集光され、高強 度パルスレーザー照射により生成される高速電子が固体タ ーゲットに侵入し原子と相互作用することにより生じる特 性X線、制動放射X線⁽²⁾であるプローブ光を発生させる。 ポンプ光は撮像タイミングの調節のための光学路遅延を行 った後に試料物質に照射される。超短パルスレーザーを用 いることで、高輝度な極短X線パルスを発生させることが 可能となる。また、固体ターゲット物質を変えることによ り、特性X線であるK線の波長を選択することができる。 この固体ターゲットへのレーザー照射によるX線発生過程 を模式的に図2に示す。



generation of hot electron penetration of hot electron Fig.2 Schematic diagram of the laser-matter interaction.

図には温度、密度のプロファイルとその位置関係を概略 的に表示した。まづ、プリパルスまたは増幅された自然放 射(ASE)に起因するプリパルスにより固体ターゲット表 面近傍に逆制動放射、真空加熱などによりプラズマが生成 される。次に、入射角 で固体表面に照射されたメインパル スのレーザー光は、レーザー生成プラズマ中を伝搬し、屈 折率がゼロになる臨界密度面までに共鳴吸収などのメカニ ズムによりエネルギーが吸収される。吸収エネルギーは主 として電子の運動エネルギーに変換され、ほぼ平面的に一 様で Maxwell 分布した高速電子 (hot electron) が生成され ると考えられている。Z<0 方向に放射された高速電子もこ れによって生じる空間荷電電場の影響によりやがては固体 ターゲット内に引き戻され、Z>0 方向に放射された高速電 子と同様に固体ターゲット内に侵入する。このようにして 固体に侵入した高速電子は静止した原子と相互作用し、原 子の励起・イオン化、および制動放射により運動エネルギ ーを失う。励起された原子は自然放射などにより光を放出 して基底状態に戻り、放射された光はさらに固体内の原子・ 電子による再吸収、散乱などの相互作用を経て外部に放射 されることとなる。

超短・高ピークパルスレーザーの固体ターゲット照射に よる超短 X 線パルスプローブ光生成や、ポンプ光による試 料物質への衝撃などの光量子 —物質相互作用過程は、マク ロスコピックな連続体の運動として記述することができる が、固体ターゲットへの超短時間でのエネルギー注入に伴 って生じる固・液・気相の多相流解析には、計算手法と、 物質の状態方程式(EOS) レーザー光と物質との相互作用 と物質内の熱輸送の物質特性値が重要となる。 計算手法としては、矢部⁽³⁾によって提案された3次補間 擬似粒子法(CIP:Cubic-Interpolated Propagation) と C-CUP (CIP-Combined Unified Procedure)法が固・液・気各相界面で の大きな密度変化を精度良く捉え、圧縮性・非圧縮性流体 の統一解法に有効な計算手法と考えられる。筆者らはこれ まで、CIP 法を異なる2種類の物質に対して適用できるよ うに拡張し、多相・多成分の連続体が存在する系に適用可 能なコード⁽⁴⁾を開発した。さらに、EOS や熱輸送モデル と物質特性値を本コードに組み込み、固体ターゲット照射 に伴う熱流動現象を解析してきた⁽⁵⁾。

この極短時間分解 X 線回折システムを用いて、例えば、 試料中にポンプ光で衝撃波を発生させることにより X 線回 折像⁽¹⁾することができる。これらは超高速現象であるた めに、実験の準備、X 線回折像解析には数値シミュレーシ ョンが重要な要件となる。但し、X 線回折像解析からは、 結晶格子間隔の動的変化が計測されるが、これを連続体運 動方程式でモデル化した場合には密度変化に対応させるこ とができるものと考える。本報告では、CIP 法と C-CUP 法 に基づき開発したコードでポンプレーザーパルス光により 試料物質中に発生するレーザー誘起衝撃波を解析した結果 を記述する。

2.支配方程式

系内に多相・多成分の流体が存在する場合、各成分の 速度、圧力及び温度が局所的に平衡状態で同一とし、流体 の内部エネルギーは各成分の内部エネルギーの和で表され ると仮定する。この時、空間平均化された質量保存式、運 動量保存式、エネルギー保存式及び各成分の質量保存式、 存在率を記述する密度関数式は以下のとおり与えられる。

$$\frac{1}{t} + u = - u \tag{1}$$

$$\frac{\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{t}} + \boldsymbol{u} \quad \boldsymbol{u} = -\frac{1}{2} \quad \boldsymbol{p} + \boldsymbol{u} + \boldsymbol{F}_{sa} + \boldsymbol{F}_{ep} + \boldsymbol{g} \tag{2}$$

$$\frac{E}{t} + u \quad E = -\frac{p}{u} \quad u + - T + \frac{Q}{2} \tag{3}$$

$$\frac{i}{t} + \boldsymbol{u} \quad (i) = -i \quad \boldsymbol{u} \quad (4)$$

$$\frac{i}{t} + \boldsymbol{u} \qquad i = 0 \tag{5}$$

$$= \underset{i \quad i \quad i}{} E = \underset{i \quad E_{i \quad i}}{} E_{i \quad i}, \qquad \underset{i \quad i}{} E^{-1} \qquad (6)$$

ここで、u は速度、 は密度、p は圧力、E は内部エネ ルギー、T は温度、 は密度関数、 F_{sa} は流体境界に働く表 面張力、 F_{ep} は弾性体応力による力、g は重力などの外力、 Q は単位時間当たりの発熱密度、 は熱伝導率、 は動粘 性係数であり、添字 i は成分を表わす。これらは時間 t、 位置座標 x の関数である。ただし、流体の各成分は連続の 式を満たすものとした。レーザー光及びふく射エネルギー はQを通じて内部エネルギーに変換される。

式(5)の密度関数_i(x,t) は成分 i の存在領域を表わす関数 であり、_i(x,t)=1 はすべてがそれで満たされていることを、 _i(x,t)=0 は全く存在しないことを意味する。流体境界では、 0 _i 1となるが、これを流体成分の存在率であると解 釈する。したがって密度関数により計算空間で物質を識別 することができ、各物質の状態方程式などの特性値の設定 や、表面張力などの計算に必要な流体境界の計算のために もちいる。 本研究では、物質は局所熱平衡状態にあるとし、エネル ギーと圧力は密度と温度の関数として次の状態方程式で与 えられるものとする。

 $E = E(_i, T), p = p(_i, T)$ (7) また、状態方程式は密度と温度についての1次偏導関数が 連続であるとする。エネルギー式は、この状態方程式によ り圧力 pに関する次の方程式に変換することができる。

$$\frac{D}{Dt} = -Pdiwu + I(T+Q)$$
(8)

但しここで、

$$= -\left(\frac{1}{p} \sum_{i=1}^{2} \left(\frac{E_{i}}{i}\right)_{p} - I\right) I$$

$$I = I\left(\sum_{i=1}^{2} \left(\frac{E_{i}}{i}\right)_{p}\right)$$
であり、1成分理想気体の場合には、を比熱比とすると

$$I = I/(\frac{E}{P}) = -I, = (\frac{2}{P}(\frac{E}{P})_{P} - I)/(\frac{E}{P}) =$$

となり、圧縮性流体の支配方程式として一般に使用されて いるものと一致し、 は状態方程式から求められ一般化さ れた比熱比と呼べる量である。

式(1)、(2)、(4)、(5)及び(8)が解くべき基礎方程式となる。 移流計算には CIP 法を採用し、非移流計算は C-CUP 法と同 様な(8)式を MICCG (Incomplete Cholesky Decomposition Conjugate Gradient)法により計算する。

EOS は、局所熱平衡の仮定のもとで Thomas-Fermi モデ ルによる電子 EOS、Cowan モデルによるイオン EOS、Barnes モデルによるコールド補正の加算により表わす。

熱伝導係数と電気伝導係数(直流成分)は、物質を高密 度プラズマとみなしてプラズマ中の定常状態における電子 の移動速度で近似する TKN モデルに基づいて計算し、各々 = (,T), 。= 。(,T)で表わす。

物質に照射されたレーザー光は $I = I_0 aexp [-z]$ により 物質中を伝搬する。ここで、1,1⁰, a, , z は各々レーザー強 度、入射レーザー強度、表面での透過率、吸収係数及び透 過距離である。レーザー光透過率、レーザー光吸収係数は、 真空に接する半空間がプラズマで満たされている状態に電 磁波が入射して生成されるエバネッセント波の空間分布か ら計算する。このとき、電気伝導率は、Drude モデル $() = \frac{2}{p}/4 (e_i - i)$ で近似できるものとする。これよ り、透過率、吸収係数は、a = a(T), = (T)で表わされ る。ここで、 は入射光の振動数、 $p = (4 Z n^{1}e)$ はプラ ズマ周波数、 $e_i = Z^{*}n_i e^2/m_e$ は電子-イオン衝突頻度、 m^{*}は電子の静止質量、e は素電荷、n¹はイオンの数密度、Z は平均イオン荷数、 clt TKN モデルで求めた電気伝導係数 (直流成分)である。

また、プラズマ中の屈折率は $(1-p^2/2)^{1/2}$ であり、臨界 密度は、p = cなる位置での電子密度であり $m_e/(4 e^2)$ で定義される。平均イオン荷数 Z²は Thomas-Fermi モデルに おける自由電子の数から求められるが、ここでは More の近 似式⁽⁶⁾をもちいる。

3.数值解析結果

解析コードに, Tの関数としての状態方程式、熱伝導係数、レーザ光透過率、吸収係数の各テーブルを組み込み、 レーザ光を固体 AI に照射した2次元(x-y)シミュレーション を行った。各格子点では、まず従属変数 、*P*から EOSの P=P(,T)により*T*を求め、必要な物性値を計算する。 図 3 に解析体系を示す。解析体系の大きさは 12 μm x 12 μm、 分割数 100 x 100 である。



Fig.2 Geometry used in the simulation.

標準状態の銀(Ag)に強度 10¹⁰W/cm²、ガウス型の空間プロ ファイル(幅 2µm)のレーザー光(波長 800nm)を表面に 垂直に照射した時の固体内の密度の等高線を図4に示す。 (但し、0< x < 12µm, 5µm< y <10µm の領域で、密度は 10g/cc から 12g/cc の範囲) 0< x < 12µm, 5µm< y <6µm の低密度 (10g/cc 以下)の領域が時間経過とともに広がっているの は固体ターゲットが溶融・蒸発しレーザー生成プラズマと なっていることを示す。また、図5にはレーザー光の中心 軸に沿ったターゲット内の密度の変化を示す。(但し、x = 6µm, 5µm< y <10µm) レーザー照射開始直後に、照射表面に 薄い高密度領域が生成され、衝撃波の先端は音速とほぼ同 じ約 3.5km/s で固体内に伝播していくのがわかる。またレー ザー誘起衝撃波は約 400ps までは平面的であるが、2次元 効果により時間とともに形状が変化して行く。600ps での先 端での圧縮率は約 20%であることから圧力は 10GPa 程度で ある。レーザー照射開始直後において衝撃波の先端がなだ らかな形状であることは、レーザー吸収係数が 0.01µm 程度 であるにもかかわらず、温度上昇に伴う熱伝導率の増加に より生じたものであると考えられる。また、レーザー照射 開始直後での密度プロファイルは、A.Ng⁽⁷⁾等のシミュレ ーション結果(ターゲット:AI)と定性的にほぼ一致する。 但し、本シミュレーションでは熱伝導フラックスは

$$F = \begin{cases} F_C, & F_C < F_L \\ F_L, & F_C > F_L \end{cases}$$
$$F_C = -K_C T$$
$$F_L = f n_\ell kT \left(kT / m_e \right)^{1/2}$$

とした⁽⁸⁾。ここで、k はボルツマン定数、 n_e は電子密度、 m_e は電子の質量、 F_c はフーリエ則に基づくフラックスで あり、 F_L はフラックスの上限である。フラックス・リミッ タ係数 f として 0.5 を設定したが、この値は半経験的なもの でありその妥当性に関しては実験との対比から今後検討を 要する。図 5 からわかるように衝撃波の先端では徐々に圧 縮領域が小さく、衝撃波の圧縮率が大きくなっている。こ のことは、衝撃波の進行方向前面の伝播速度に比して、後 面がすでに加熱されているためにこの波の進行速度が大き いことから理解される。





Fig. 4 Density contours in the case of 10¹⁰W/cm² laser irradiation with gaussian spatial profile onto the Ag solids.

Copyright © 2000 by JSCFD



Fig. 5 Evolution of the density profile at the center of solid.

レーザー光は連続的に照射を続けているために、衝撃波 の後方に高圧力領域が広く形成されると考えたが、シミュ レーションからは薄い円盤状の衝撃波が固体ターゲット内 を伝播するという結果となった。このことは、照射面では アブレーションによりプラズマが生成されていて、照射の 初期以降においては、レーザー光は主としてレーザー生成 プラズマにより吸収され固体ターゲットには熱伝導により 比較的ゆっくりとエネルギー伝播されるからではないかと 推測している。現時点では衝撃波の形状を観測したデータ がないためにこの推測を正当化するための実験を期待して いる。なお、この現象解析ではプラズマによるレーザー光 吸収係数、高温領域における熱伝導係数が重要であり、レ ーザー生成プラズマ状態の実験との比較検討からこれらの 係数の補正が必要である。

一方、レーザー生成プラズマ領域のシミュレーションに おいてしばしば負の圧力が現われてしまう。これは、使用 した SESAME 状態方程式(図6参照)が低温(1eV以下) 領域において精度が十分でないことに起因しておこる数値 シミュレーション上の問題である。高強度プローブ光によ る固体ターゲット照射においては高温領域の状態方程式を 用いるためにこの種の数値的問題はあまり現われなかった が、強度の低いポンプ光照射による固体の溶融・蒸発シミ ュレーションでは低温領域でのデータが重要となってくる。 特に、凝縮のような過程を含むレーザー加工シミュレーシ ョンなどでは、ファンデル・ワールス・ループのモデル化 を検討しなくてはならない。この時、シミュレーションに もちいられる一般化比熱比は

$$= -\left(\frac{P}{P}\left(\frac{E}{P}\right)_{P}-1\right) / \left(\frac{E}{P}\right)$$

$$= -\frac{V}{P}\frac{C_{P}}{C_{v}}\left(\frac{P}{V}\right)_{P}=\left(\frac{\ln P}{\ln n}\right)_{T}$$

$$_{I} = 1 / \left(\frac{E}{P}\right)$$

$$= \frac{1}{C_{v}}\sqrt{\frac{B}{T}(C_{p}-C_{v})}$$

$$= C_{P} / C_{v}$$

$$B = -V\left(\frac{P}{V}\right)_{T}$$

のように定積比熱、定圧比熱、体積弾性率などの測定量と 関連づけられることを考慮しなくてはならない。



Fig.6 SESAME EOS data(ID=2720; Ag) used in the simulation.

4.まとめ

CIP 法と C-CUP 法に基づき開発したコードでポンプレー ザーパルス光により試料物質中に発生するレーザー誘起衝 撃波を解析した結果を記述した。

X 線回折像解析からは、結晶格子間隔の動的変化が計測 されるが、これを連続体運動方程式でモデル化した場合の 密度変化に対応させることができる。このことにより、今 後、レーザー照射実験に重要なデータであるレーザー吸収 係数、熱伝導係数、状態方程式(EOS)の妥当性、高精度 化を X 線回折と数値シミュレーションにより検証して行く 予定である。

参考文献

- (1) T. Guo et. al., SPIE Vol. 3157(1997), pp. 84-92.
- (2) A. Zhidkov et.al, Phys. Rev. E, 62(2000), pp. 7232-7240.
- (3) T. Yabe and T. Aoki, Comput. Phys. Commun., 66 (1991) pp.219-232.
- (4) 内海、藤井、伝熱研究、7(1) (1999) pp.21-31.
- (5) T. Utsumi, A. Sasaki, T. Kunugi, S. Fujii and M. Akamatsu, CFD journal, 8(1), (1999)pp.128-134.
- (6) R.M. More, Adv. At. Mol. Phys., 21(1985) pp.305.
- (7) A. Ng, A. Forsman, and P. Celliers, Phys. Rev. E, 51 (1995) R5208.
- (8) R.C. Malone, R.L. McCrory, and R.L. More, Phys. Rev. Lett, 36(1976)35.